(9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A)

昭58-172245

① Int. Cl.³ C 03 C 17/30 C 09 K 3/18 #C 07 F 7/08 識別記号 104 庁内整理番号 8017—4G 7229—4H 7329—4H ❸公開 昭和58年(1983)10月11日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

64ガラスの表面処理剤

0)特

願 昭57-53721

20出

願 昭57(1982)4月2日

790平

者 小田吉男

横浜市保土ケ谷区上菅田町435

仍発 明 者 松尾仁

横浜市緑区大熊町39

⑫発 明 者 山岸展幸

横浜市旭区鶴ケ峰2-59-1

⑪出 願 人 旭硝子株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目1

番2号

個代 理 人 弁理士 内田明

外1名

明細 11

1. 発明の名称 ガラスの表面処理剤

2. 特許請求の範囲

(1) 一般式 {Rf(X)_DCONA}_aB1(Z)_bY¹4-a-b で | | | R¹

安わされるポリフルオロアルキル基含有シラン化合物又は該化合物の部分加水分解縮合物と、一般式 51R²cY²₄-cで表わされるシラン化合物とからなるガラスの表面処理剤。

(但し、上記一般式において、Rf は炭素数1~20個のポリフルオロアルキル基であつてエーテル結合を1個以上含んでいてもよい、Rf 及び呼は水素原子又は低級アルキル基、Xは一CON(Rf)-Q- (但下の有機基を示す。)、Aはアルキレン基、2は低級アルキル基を又はR²COO- (但し、Riは水素原子又は1~2の整数、bは1~3の整数、bは1~2の整数、

cは.0又は1~2の整数を示す。]

(2) R f が炭素数 1 ~ 2 0 個のパーフルオロアルキル基である特許翻求の範囲第 1 項記載の表面処理剤。

. CF: CF:

(3) Rまが CF₂CF₂CF₂O(CFCF₂O)_mCF-(但し、m は1以上の整数)である特許翻求の範囲第1 項記載の表面処理剤。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、ガラス表面に撥水性、撥油性、耐汚染性、低反射性などを付与する処理剤に関し、更に詳しく言えば、ポリフルオロアルキル基合有シラン化合物又は、酸化合物の部分加水分解縮合物とアルコキシあるいはハロゲノ等シラン化合物とからなる新規なガラスの表面処理剤に関するものである。

ガラス板、鏡、ガラス容器、ガラス器具、メガネレンズなどガラス製品の表面は大気中の遊 度及び温度の影響により水分が凝縮したり、水 によつて漏らされた場合、これら水分中にガラ

特開昭58-172245(2)

本発明者は、前記の如き問題点の認識に基づいて、ガラス表面に撥水性、撥油性、耐汚染性などを長期間にわたつて付与し得る使れたガラス表面の処理剤を提供すべく種々研究、検討を重ねた結果、本発明を完成したものである。

はハロゲノ等シラン化合物を混合使用するとガラスとの接着面における架橋度が増大し、接着性及び撥水撥油性が向上し、高性能の表面処理剤が得られるという事実を見出したものである。また、からる特定の装面処理剤の薄膜をガラス表面に形成させると、反射率が小さくなり、その結果ガラスの透視性などの阻害要因を解消可能であるといり利点も発揮される。

かくして、本発明は前記知見に基づいて完成 されたものであり、

一般式
$$\{Rf(X)_nCON-A\}_{a}81(Z)_bY^1_{4-a-b}$$
 (I)

〔但し、R f は炭素数 1 ~ 2 0 個のポリフルオロアルキル港であつてエーテル結合を 1 個以上含んでいてもよい、 R は水素原子又は低級アルキル港、 X は − CON(R²)−Q− 又は − SO₂N(R²)−Q− (但し、 R k は水素原子又は低級アルキル基、 Q は二価の有機基を示す)、 A はアルキレン基、 2 は低級アルキル港、 Y 及び Y はそれぞれハロゲン、アルコキン基又は R³ COO− (但し、 R³ は

即ち、本発明者の研究によれば、ポリフルオ ロアルキル基(以下、R.C 蓋と略す)含有の表 面処理剤において R.f. 基の臨界表面張力は 2 0 dyn /m以下と低く、水はもとより油類のそれ よりも低いため、 Rェ 基がガラス表面を覆りと 撥水般油性が付与できること、さらに、R1 基 をガラス表面に効率よく配向させるにはアミト 基が有用であり、 撥水撥油性を高める機能を付 与し得るという事実を見出した。又、Rf 基合 有化合物をガラス表面へ強固に接着して、撥水 触油性を長期にわたり付与するためにはガラス 表面の SiOH 基と反応する -Si-O-R . -Si-Hal (IIa1 はハログン) の存在が好ましく、かゝる -81-0-R をどは水の存在で加水分解し、架橋反 応を起すこと及びガラス表面の B10H と反応し てガラス表面に化学的に接着し得ることが可能 とたる。

而して、本発明者の研究によればRr 基合有化合物とシラン化合物の反応により合成されるRr 基合有シラン化合物に、アルコキシあるい

水素又は低級アルキル基)、 n は 0 又は 1 の整数、 a は 1 ~ 3 の整数、 b は 0 又は 1 ~ 2 の整数を示す。〕で表わされる R 2 基含有シラン化合物又は酸化合物の部分加水分解縮合物と、一般式 S1R² cY² 4-c (0) (但し、 R² · Y² は前配と同い、 c は 0 又は 1 ~ 3 の整数)で表わされるシラン化合物からなる新規なガラスの表面処理剤を提供するものである。

特開昭58-172245(3)

分 加水 分解 縮合物 と、一般式 (11) のシラン 化合物 と からなるが、 R を 善含有シラン 化合物 の R f は 炭素数 1 ~ 2 0 個 の パーフルオロアルキル基 あるいはエーテル 結合を 1 個以上含む

CF₃ CF₃

CF₂ CF₂ CF₂ O (CFCF₂ O) m CF- であるのが望ましく、 特 に 炭素数 4 ~ 1 2 個のパーフルオロアルキル 基、 m は 2 ~ 1 0 の整数であることが好通であ る。 R¹ は水素原子又は炭素数 1 ~ 4 の低級アル キル基のいずれでも良い。 X は -CON(R²)-Q- 又 は -SO₂ N(R²)-Q- が選定されるが、 Ptは水素原子 又は炭素数 1 ~ 4 の低級アルキル基であり、 Q は二価の有機基で、 好ましくは -(Cb₂)₂-

であり、 a は 1 ~ 3 の整数であり、 b は 0 又は 1 ~ 2 の整数である。

而して、一般式(I)のRf 基含有シラン化合物は循々の方法あるいは経路で入手され得るが、通常はRf(X)n-COOR1 化合物とH2NAS1Y2 化合物との反応を含む工程によつて合成される。かかる合成反応は活性水素をもたない溶媒を使用してもよく、反応温度は0~150で、好ましくは40~80で、反応時間は1~50時間、好ましくは2~10時間で行われる。

本発明において、一般式(I)のRI 基合有シラン化合物としては、例えば C₈ F₁₉ CONH(CH₂)₃ S1(OC₂H₅)₃. C₈ F₁₉ CONH(CH₂)₃ S1Cl₃.

CH₃

C₉ F₁₉ CONH (CH₂)₃ B 1 Cl₂,

C₉ F₁₉ CONH (CH₂) NH (CH₂)₃ B 1 (OC₂ H₅)₃.

C₉ F₁₉ CONH (CH₂)₅ CONH (CH₂)₂ B 1 (OC₂ H₅)₃.

C₈ F₁₇ SO₂ NH (CH₂)₅ CONH (CH₂)₂ B 1 (OC₂ H₆)₃.

CF₃ CF₃ (また) (など) (C₃ F₇ O(CFCF₂ O)₂ - CF - CONH(CH₂) 8 1 (OC₂ H₅)₃ が挙げられる。

一般式(II) 81R²c Y²4-c のシラン化合物において、 PCは水素原子又は炭素数 1 ~ 4 の低級 アルキル基、 Y²はハロゲン又は炭素数 1 ~ 4 個のアルコキン基あるいは R²COO- から選定され、好ましくは C1 . -OCH₅ . -OC₂H₅ . CH₅COO- , C₂H₅COO- である。

本発明の処理剤は一般式(1)のRI 基合有ション化合物と一般式(1)のRI 基合有ション化合物とを混合することにより提供されるが、両化合物を水とができる。両化合物の混合割合はRI 基合有ション化合物に対してション化合物に対してション化合物に対して1000をある。水のである。株のましくは100~500年ルダである。

かくして得られる本発明の処理剤は、常法に

本発明のガラスの表面処理剤は彼処理ガラスと製品の形状や前記調整に応じて任意の方法で被処理ガラス製品に適用され得る。例えば、欧付けなどの如き被援加工の既知の方法によりガラス製品の表面に付着させる方法が採用され得る。ガラス製品の最直に付着後は100%相対虚殴下、100℃以上の温度で20分間以上の処理を施こすのが好ましく、処理剤のガラス要のへ



持網昭58-172245 (4)

の接着を強固なものとなし得る。

本発明の処理剤は他のRf 基含有化合物、各種重合体、その他のプレンダーなどを混合しても良く、さらに帯電防止剤、架橋剤など適宜葯加剤を添加して使用することも可能である。

本発明の表面処理剤で処理され得るガラス製品は特に限定されることなく種々の例が挙げられ、例えば、ガラス板、鏡、ガラス容器、ガラス器具、メガネレンズなどに適用され得る。

本発明の処理剤の評価法は、撥水性はガラス表面上に水を備き接触角を測定することにより行いた。また、反射率は、正反射光測定付属装價付323形(日立製作所社製の自動記録分光光度計)を使用して、入射角5°で測定した。尚、強製の厚みは、"タリステップ"(Rank Taylor/Hobson社製)を使用し、針圧を制定して求めた。

次に本発明の実施例について、さらに具体的に説明するが、との説明が本発明を限定するも

反応生成物はガスクロマトグラフィーで分析

すると CF3 OF2 CF2 O (CF CF2 O)2 CP CONH (CH2)3 Si (OC2 H5)3 であり、転化率は100多であつた。 実施例1

合成例 1 で合成した CnF2n+1 CONH(CH2) 3 81 (OC2H5) 3 (n は 6 . 8 . 1 0 . 1 2 の混合物であり平均値は 9 0) 7 1 7 9 (0 1 モル) 、 S1(OC2H3) 4 3 5 8 9 (0 2 モル) 、 水 6 6 0 9 (0 3 7 モル) を温度計及び攪拌機を装着した内容積 2 5 0 元の三つロフラスコに仕込み、 2 5 でで攪拌しながら 1 0 分間反応後、 H2 80 4 0 2 9 を添加してさらに 2 5 でで攪拌しながら 2 0 分間反応を行い、 CnF2n+1 CONH(CH2) 3 8 1 (OC2H5) 3 / 8 1 (OC2H5) 4 の反応生成物を得た。

前記反応生成物209をフロン(R-113 :旭硝子社製品)で稀釈して1009とし、裕 剤溶液を調製した。別に、洗剤及びアセトンで 洗浄し、19塩酸溶液に浸漬後乾燥したガラス 板(ソータ石灰ガラス)を用意して、表面に調 のでないことは勿論である。 合成例 1

Cn 2n+1COOCH(OH₂)₂ (nは 6.8.10,
12の混合物であり平均値は 9.0) 111.2 6
(0.2 モル)、 H₂N(CH₂)₂81(OC₂H₅)₃ 4 4.2 9
(0.2 モル)、 乾燥テトラヒドロフラン 1 5 0
9 を、 温度計、 冷却管及び複拌機を装着した内容核 5 0 0 配のガラス製四ツロフラスコに入れ、乾燥 環気流下でゆつくり 撹拌しながら遺流温度(約60℃)で 5 時間反応させた。 テトラヒドロフランを溜去し反応生成物を 役た。 反応生成物は ガスクロマトグラフィーで分析すると Cn F_{2n+1}CONH(CH₂)₃81(OC₂H₅)₃ であり、 転化率は 1 0 0 % であつた。

合成例2

CP₃ CP₃ CP₃ CP₃ CP₃ CP₃ CP₂ CP₂O(CPCP₂O)₂CPCOOC₂H₆ 6 9 0 9 (0.1 モル)、H₂N(CH₂)₃B1(OC₂H₅)₃ 2 2 1 9 (0.1 モル)、乾燥テトラヒドロフラン 1 5 0 9 を合成例1と同様の方法で反応させた。

製済みの溶剤溶液をアブリケーターで塗布し、100分相対湿度中、120℃、20分間キュアリングを行つた後、水及びヘキサデカンの接触角を測定した。測定結果を第1表に示す。 実施例2

実施例 1 における CnF2n+1 CONR(CH2) 381(OC2H3)3 / 81(OC2H3)4 の反応生成物 5 9 を、R - 1 1 3 / アセトン混合 部鉄 (3 / 1) で稀釈して 500 9 とし、 密剤 密液 を調製した。 別に洗剤 及びアセトンで洗浄し、 1 多塩酸 溶液に 浸渍 後乾燥 したか ラス板 (ソーダ石灰ガラス) を用意した。 このガラス板 を削配溶剤 溶液 中に浸漬 し、引上速度 5 0 cm / 分で引き上げ、 1 6 0 でで 1 時間 乾燥した。 膜厚は Q 1 μ であり、 反射率は 1 1 9 であつた (光の 放長 5 4 0 m μ)。 尚、未処理ガラス板の反射率は 4 2 9 であつた。 実施例 3

CF:

合成例 2 で合成した CF2 CF2 CF2 O(OF CF2 O)2

CP。
| CFCONH(CHi):81(OC2Hs): と 81(OC2Hs)4 を実施例1と同様の方法で反応させて CP2 CP2 CP2 O

CF3 CF3 (CF3 (CFCP20)2 CFCONH (CH2)3 S1 (OC2H3)3 / S1 (OC2H3)3 / S1 (OC2H3)4 の反応生成物を得た。この反応生成物を実施例1 と同様の方法でガラス板の塗布、処理後、水及びヘキサデカンの接触角を測定した。測定結果を第1 表に示す。

実施例 4

実施例 2 において、実施例 1 の反応生成物の代 りに実施例 3 の反応生成物を使用した他は、同様に処理し、 誤厚 0.1 μ の pp を ガラス 板 表面 に形成した。 反射率は 1.0 % であつた。 比較例 1 ~ 2

合成例 1 で合成した C_nF_{2n+1}CONH(CH₂)₃Si (OC₂H₅)₃及び合成例 2 で合成した CF₃CF₂CF₃O CF₃ CF₃ (CFCF₂O)₂CFCONH(CH₂)₃Si(OC₃H₅)₃ を実施例

1と同様の方法でガラス板に塗布、処理後、水

例1と同様の方法でシラン化合物と反応させ、 反応生成物をガラス板表面に塗布、処理し、水 及びヘキサデカンの接触角を測定した。

測定結果を第2表に示す。

第 2 表

	生 成 物	接触角	
		*	ヘキサ デカン
実施例 5	$C_n F_{2n+1} CONH(CH_2)_3 SI(OC_2H_5)_3$ $/ SI(OC_2H_5)_4$ $(\overline{n} 6)$	1 2 3°	8 5°
w 6	$C_n F_{2n+1} CONH(CH_2)_3 S1(OCH_3)_3$ $\nearrow S1(OC_2H_3)_4$ $(\overline{n} ?)$	1 1 5°	7 5 °
# 7	$c_n F_{2n+1} cone(ch_2)_3 s1(ococh_2)_3$ $/ s1(oc_2 h_3)_4$ $(\overline{n} 9)$	1 1 7°	7 6°
₹ 8	CH ₃ $C_n F_{2n+1} conf(cH_2)_3 si(oC_2 H_6)_2$ /Si(oC ₂ H ₆) ₄ (\overline{n} 9)	1 1 4°	7 5°
# _. 9	CH ₅ C ₈ F ₁₇ SO ₂ N(CH ₂) ₅ S1(OO ₂ H ₅) ₈ /S1 (OO ₂ H ₅) ₄	.1 1 5°	7 6°
# 10	OnF _{2n+1} CONH (CH ₂) ₂ NH (CH ₂) ₃ S1 (OC ₂ H ₃) ₄ /Si(OC ₂ H ₃) ₄ (n 9)	1 1 3°	7 2º

及びヘキサデカンの接触角を測定した。それぞれの測定結果を第1表に示す。

第 1 表

	生 成物	接触角	
		水	ヘキサ デカン
実施例1	$C_n F_{2n+1} CONH (CH_2)_5 S1 (OC_2H_5)_3$ $/ S1 (OC_2H_6)_4 (n 9)$	1 2 5°	8 5°
7 3	CF ₃ CF ₃	1 2 0°	8 1°
比較例1	C _n F _{2n+1} совн (сн ₂) ₃ в 1 (ос ₂ н ₆) ₃ (n/n)	105°	7 0°
4 2	CF ₃ CF ₃ CF ₃ CF ₃ CF ₃ CF ₂ CF ₂ C CF CF ₂ C CF CONH (CH ₂) ₃ S1 (OC ₂ H ₆) ₈	9 5°	6 5°

实施例 5 ~ 1 0·

Rf 基含有シラン化合物を異にする他は合成例1と同様の方法で反応生成物を得た後、実施

実施例 1 1

実施例 2 において、実施例 1 の反応生成物の代 5 に実施例 1 0 の生成物を使用した他は同様に処理したガラス板の反射率は 1.2 % であつた。 実施例 1 2 ~ 1 4

合成例1で得た CnF2n+1 CONH(CH2) 3 S1(OC2H5) 3 を使用して、シラン化合物を異にする他は実施例1と同様の反応方法で得た反応生成物をガラス表面に塗布、処理し、水及びヘキサデカンの接触角を測定した。測定結果を第3表に示す。

第 3 表

			接触角	
	生 以物	水	ヘ キサ デカン	
実施例12	$c_n F_{2n+1} conh(ch_2)_3 si(oc_2 h_5)_3$ / sicl ₄ (\overline{n} 9)	120°	80°	
# 13	$c_n F_{2n+1} conh(ch_2)_3 si(oc_2 h_6)_3$ /HS1cl ₃ (\overline{n} 9)	1 18°	7 8°	
# 14	$C_n F_{2n+1} CONH(CH_2)_3 S1(OC_2H_6)_3$ $/ CH_3 S1Cl_3$ $(\overline{n} 9)$	1 1 6°	7 8°	



THIS PACE BLANK DOOR ON